NEWS RELEASE
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー
https://www.mitsuichemicals.com
三井化学株式会社

2026年11月25日
三井化学株式会社

三井化学グループ、「SEMICON®JAPAN 2026」に出展

三井化学株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：市村 聡）、三井化学ICTマテリア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：才本 芳久）、本州化学工業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平岩 健司）、三井化学ファイン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 久義）、および株式会社三井化学分析センター（本社：千葉県袖ケ浦市、代表取締役社長：鶴田 智）は、2026年12月9日から11日に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON®JAPAN 2026」に三井化学グループ5社で出展いたします。

ブース内では、世界シェアNO.1のウエハ裏面研削用保護テープ「イクロステープ™」やフォトマスク用防塵カバー「三井ペリクル™」をはじめ、フッ素フリー高耐熱離型フィルム「パルトレフ®」、耐熱仮固定用ポリイミド樹脂「ピバール®」、フォトレジスト原料「ミレックス®」、さらにPFAS代替ソリューション、材料分析ソリューションなど、幅広い工程で世界の半導体製造の未来を支える最新ソリューションの提案を致します。



【展示会概要】

展示会名: 「SEMICON®JAPAN 2026」
開催期間: 2026年12月9日（水）～11日（金）10：00～17：00
会　　場: 東京ビッグサイト（東京国際展示場）西展示棟 2ホール
三井化学グループブース　W2943
（三井化学、三井化学ICTマテリア、本州化学工業、三井化学ファイン、三井化学分析センター共同ブース）

＊ご来場の際は、SEMICON® Japan公式サイトより事前登録をお願いいたします。Home | SEMICON Japan

【三井化学グループ出展内容】

製品・ソリューション	特長・用途	担当部署
三井ペリクル™	リソグラフィ工程でフォトマスクを異物から守る防塵カバー	三井化学(株) 半導体・光学材料事業部
パルトレフ®	フッ素フリーの高耐熱離型フィルム	三井化学(株) ICT 材料事業推進室
ピバール®	仮固定プロセス向けの耐熱仮固定用ポリイミド樹脂	三井化学(株) ICT 材料事業推進室
ミレックス®	感度・解像度・耐久性に優れたフォトレジスト用原料	三井化学(株) ICT 材料事業推進室
半導体市場向けの オレフィン系ポリマー	耐熱・低誘電・耐薬品樹脂	三井化学(株) 先端材料・ソリューション研究所
エポキー®	封止樹脂・接着層の界面密着を高めるエポキシ樹脂プライマー	三井化学(株) コーティング・機能材事業部
PFAS 代替ソリューション	TPX、UHMW-PE、オレフィン系ポリマーによる PFAS 代替提案	三井化学(株) 企画管理部
イクロステープ™	バックグラインド、ダイシング、樹脂封止工程に使用する 半導体製造工程用テープ	三井化学 ICT マテリア(株)
高熱伝導性材料	AI 半導体・パワー半導体の放熱に貢献する樹脂	本州化学工業(株)
電子材料用アミン化合物	ポリイミド樹脂用モノマー、エポキシ樹脂用硬化剤	三井化学ファイン(株)
半導体材料分析 ソリューション	ポリマー分析や微小異物・微量金属分析で原因究明から 対策検討までを支援する分析ソリューション	(株)三井化学分析センター

以 上

＜お問合わせ先＞
三井化学株式会社 ICT ソリューション事業本部 企画管理部 TEL：03-6880-7474
コーポレートコミュニケーション部 TEL：03-6880-7500
お問合せフォーム https://form.mitsuichemicals.com/corporate/cc_pr_csr_ja?param=13